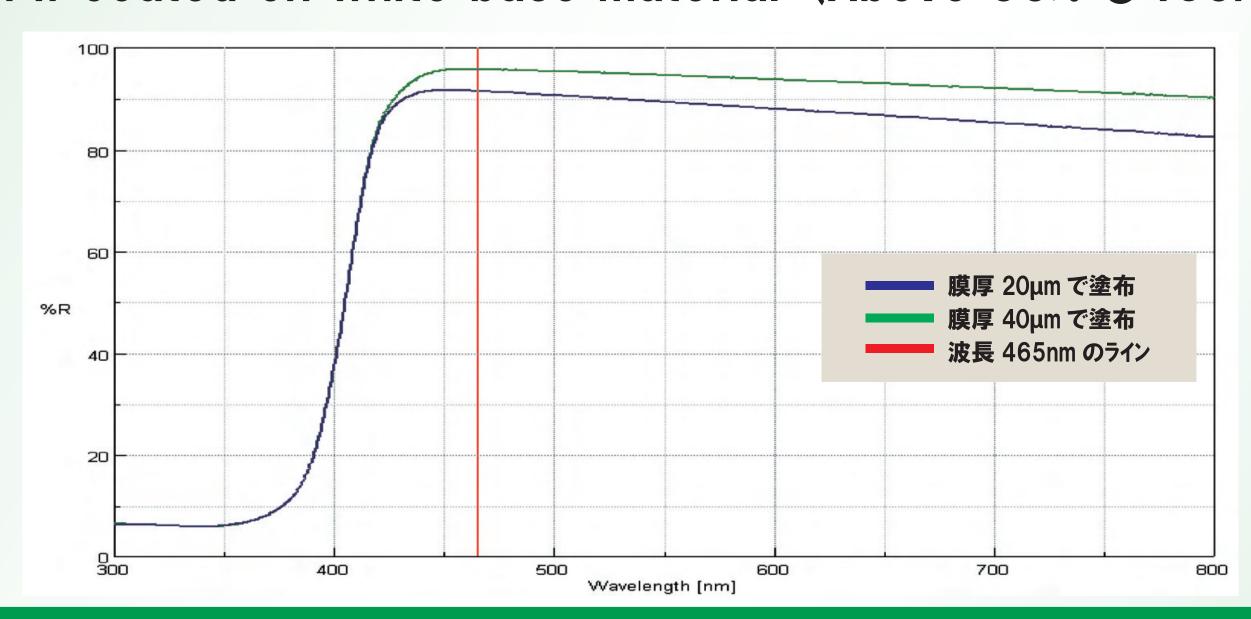
アルカリ現像型白色レジスト

Alkaline developable white resist

- **反射性に優れる 反射率 90% (465nm 膜厚 20μm)** Excellent reflectance 90% @465nm, (thickness 20μm)
- フォトリソ工法により微細形状の加工が容易
 Easy high-resolution production by Photolithography process
- 可とう性のある基材に追従 Applicable to flex material
- 低温プロセスで、樹脂基材に対応
 Applicable to resin base material under low temp process
- 耐熱のあるタイプも用意(オーバーコート用) High heat resistance version available (for overcoating)
- 白色基材の上に形成することにより、より高い反射率を有する (95%以上 465nm) Even higher light reflection if coated on white base material (Above 95% @465nm)



紫外線硬化型白色材料

UV-curable white material

- 高反射率 High reflectance
- 一紫外線硬化(低温硬化可能) UV-curable (Low temperature curable type)
- 高変色耐性 Superior discoloration resistance

試験項目 Test Items	試験条件 Test Condition	L*a*b*	反射率 Reflectance
初期值 Initial		940.9.0.2	87%
耐光性 Light resistance	積算光量 150J/cm ²	941.3.1.3	85%
耐热性 Heat resistance	150°C 50hrs.	941.9.3.4	82%

